

Prensa Caliente Automática Al Vacío De 10T Para Prensado De Laboratorio De Precisión

Número de artículo: XP32



Introducción

Prensa caliente automática al vacío de sobremesa de alta precisión de 10T con platina calefactada de 200x200mm y bomba de vacío rápida para curado de polímeros, unión de electrodos de batería e investigación de materiales. Ideal para entornos de laboratorio que requieren calentamiento uniforme y control de presión de precisión, certificada CE con pantalla táctil programable.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio Clave
Laminación de Películas Poliméricas	Laminación de láminas o películas poliméricas bajo calor y vacío para crear estructuras multicapa.	La presión y temperatura uniformes evitan deformaciones y huecos.
Unión de Electrodo de Batería	Unión de materiales de electrodos a colectores de corriente para baterías de iones de litio o de estado sólido.	El purgado con gas inerte previene la oxidación, asegurando una alta conductividad.
Compactación de Polvos (con Troqueles)	Compactación de polvos metálicos, cerámicos o compuestos en gránulos densos utilizando un troquel más pequeño.	Alta presión de hasta 50.9 MPa alcanzable con troquel de Ø50 mm.
Procesamiento de Películas Delgadas	Curado y recocido de películas delgadas para aplicaciones de electrónica y sensores.	Control de temperatura preciso de hasta 300°C con entorno de vacío.
Sinterizado de Cerámica	Sinterizado en etapa inicial de cuerpos cerámicos verdes bajo calor y presión combinados.	Porosidad reducida y propiedades mecánicas mejoradas.
Curado de Materiales Compuestos	Curado de preimpregnados de fibra de carbono o fibra de vidrio.	La distribución uniforme de la presión asegura la calidad de la laminación.
Encapsulación de Electrónica Orgánica	Encapsulación de dispositivos electrónicos orgánicos sensibles bajo atmósfera inerte.	El entorno libre de oxígeno extiende la vida útil del dispositivo.

Parámetro	Especificación	Notas
Modelo	XP32	Prensa caliente automática al vacío
Presión Máxima de Trabajo	≤ 10 Toneladas (100 kN)	Controlada mediante sistema programable
Precisión de Presión	± 0.1 Tonelada (1 kN)	Retroalimentación de carga de alta precisión
Temperatura de Trabajo de la Platina	Temperatura Ambiente (RT) - 300 °C	Pantalla táctil PID programable
Potencia de Calefacción	3500 W	Conjunto de elementos calefactores de alta densidad
Dimensiones de la Platina	200 mm x 200 mm	Platinas rectificadas planas
Apertura de la Platina (Luz del Día)	50 mm	Apertura compacta para ciclo de vacío rápido
Bomba de Vacío Incluida	Bomba Mecánica de Paletas Rotativas	Inclusión estándar
Desplazamiento de la Bomba de Vacío	240 L/min (8.5 CFM)	Capacidad de evacuación de alta velocidad

Parámetro	Especificación	Notas
Nivel de Vacío Final	< -0.1 MPa	Presión relativa manométrica
Atmósfera de Trabajo	Nitrogeno (N ₂) / Argón (Ar)	Compatible con vacío-y-purgado
Fuente de Alimentación	AC 208V / 60Hz (Monofásica)	Optimizada para instalaciones institucionales de EE.UU.
Certificación	Certificación CE	Cumplimiento estándar de seguridad

Opción	Controlador Estándar (Incluido)	Actualización a PLC Industrial Avanzado (Opcional)
Interfaz	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas	PLC industrial Siemens con pantalla táctil de alta resolución
Funciones Principales	Perfilado básico de temperatura PID, entrada de presión objetivo, mantenimiento automático, descompresión temporizada automatizada	Perfilado complejo de temperatura/presión de múltiples pasos, almacenamiento de recetas (hasta 99 perfiles), retroalimentación precisa de célula de carga, registro de datos por Ethernet
Ideal Para	Laminación estándar, curado de polímeros, prensado simple de gránulos	Investigación académica, estándares de prueba ASTM, procesos que requieren compensación de presión paso a paso precisa